

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】令和2年4月9日(2020.4.9)

【公開番号】特開2020-12007(P2020-12007A)

【公開日】令和2年1月23日(2020.1.23)

【年通号数】公開・登録公報2020-003

【出願番号】特願2019-195624(P2019-195624)

【国際特許分類】

C 07 F 7/18 (2006.01)

C 07 B 61/00 (2006.01)

【F I】

C 07 F 7/18 X

C 07 B 61/00 300

【手続補正書】

【提出日】令和2年2月20日(2020.2.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

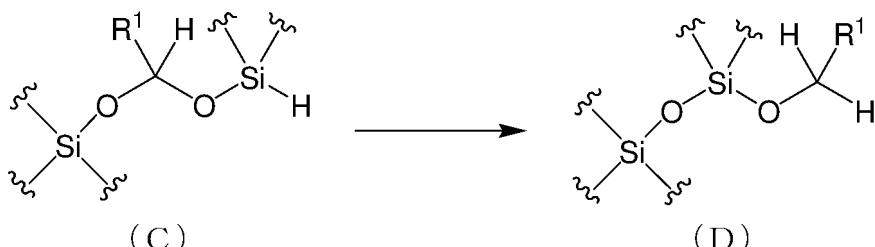
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ルイス酸の存在下、下記式(C)で表される構造を有するシリルアセタールを反応させて下記式(D)で表される構造を有するオリゴシロキサンを生成する転位工程を含むことを特徴とするオリゴシロキサンの製造方法。

【化1】



(式(C)～(D)中、R¹は水素原子、又は炭素原子数1～18の炭化水素基を表す。)

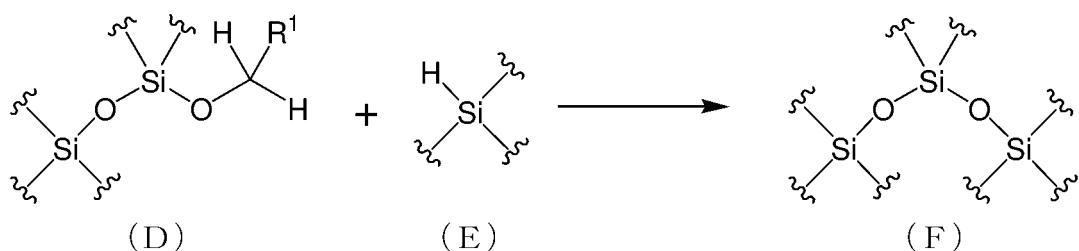
【請求項2】

前記ルイス酸が、ルイス酸性を有するホウ素化合物である、請求項1に記載のオリゴシロキサンの製造方法。

【請求項3】

ルイス酸の存在下、前記転位工程で得られた式(D)で表される構造を有するオリゴシロキサンと下記式(E)で表される構造を有するヒドロシランを反応させて下記式(F)で表される構造を有するオリゴシロキサンを生成する置換工程を含む、請求項1又は2に記載のオリゴシロキサンの製造方法。

【化2】

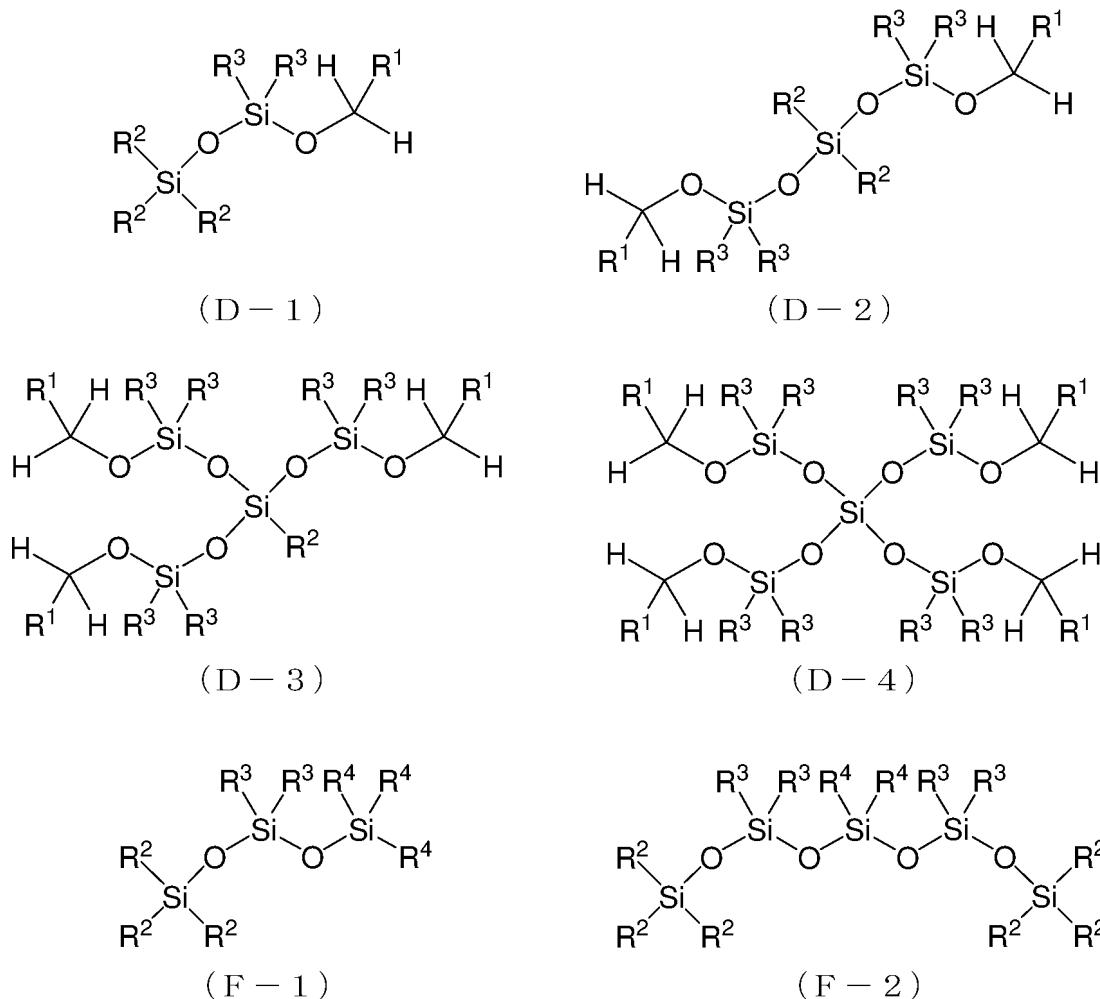


(式 (D) ~ (F) 中、 R^1 は水素原子、又は炭素原子数 1 ~ 18 の炭化水素基を表す。)

【請求項 4】

下記式 (D-1) ~ (D-4) 及び下記式 (F-1) ~ (F-2) の何れかで表されるオリゴシロキサン。

【化3】



(式 (D-1) ~ (D-4) 及び式 (F-1) ~ (F-2) 中、 R^1 は水素原子、又は炭素原子数 1 ~ 18 の炭化水素基を、 R^2 はそれぞれ独立して炭素原子数 1 ~ 18 の炭化水素基、炭素原子数 1 ~ 12 の炭化水素基を有するアルコキシ基、炭素原子数 3 ~ 18 の炭化水素基を有するシリルオキシ基、炭素原子数 1 ~ 18 の炭化水素基を有するアシリルオキシ基、又はハロゲン原子を、 R^3 及び R^4 はそれぞれ独立して水素原子、炭素原子数 1 ~ 18 の炭化水素基、炭素原子数 1 ~ 12 の炭化水素基を有するアルコキシ基、炭素原子数 3 ~ 18 の炭化水素基を有するシリルオキシ基、又はハロゲン原子を表す。)